GaN ナノコラム上 InGaN/GaN 単一量子井戸の構造・光学特性

Structural and optical properties in InGaN/GaN single quantum wells on GaN nanocolumns 1. 上智大理工 2. 上智大ナノテク

^O大音 隆男¹, 水野 祐太郎¹, 吉田 純¹, 柳原 藍¹, 宮川 倫¹, 江馬 一弘^{1,2}, 岸野 克巳^{1,2}

1. Sophia Univ. 2. Sophia Nanotech. Res. Center

^oT. Oto¹, Y. Mizuno¹, J. Yoshida¹, Y. Yanagihara¹, R. Miyagawa¹, K. Ema¹², and K. Kishino¹²

E-mail: takao.oto@sophia.ac.jp, kishino@sophia.ac.jp

InGaN ナノコラムは、貫通転位の抑制や高い光取り出し効率、歪緩和 効果により優れた発光特性を有する.本研究室では、Tiマスクを用いた 選択成長法によって、系統的に形状を制御した GaN 系ナノコラムの作製 を行い、コラム径を~26 nm まで細線化することに成功した[1].これまで に、コラム径 D_{GaN} の異なる GaN ナノコラム上に成長した InGaN ナノコ ラムにおいて、構造特性と光学特性を対応させて、ナノ構造効果が光学 特性に与える影響について議論してきた[2,3].あるコラム径 D_0 を境に 大きく構造・光学特性が異なることを明らかにした. $D_{GaN} \leq D_0$ では、In 組成の均一な InGaN ナノコラムが成長することからシングルピークの発 光を有し、表面がむき出しになるため表面再結合の影響が顕著になるこ とがわかった.一方、 $D_{GaN} > D_0$ では自発的に InGaN/InGaN core-shell 構造 を有するためダブルピーク発光を有し、core のコラム径が一定値に収束 することから core の PL 寿命は一定値となった。本研究では、InGaN ナ ノコラムの特性を基にして、GaN ナノコラム上に作製した InGaN/GaN 単一量子井戸(SOW)の光学特性のコラム径依存性を評価した.

光学測定に用いた試料は周期 150 nm の規則配列 GaN ナノコラム上に InGaN/GaN SQW を成長した構造である.図1 に(a) $D_{GaN}=62$ nm, (b) $D_{GaN}=84$ nm, (c) $D_{GaN}=106$ nm の GaN ナノコラム上に成長した InGaN SQW の4 K における規格化 PL スペクトルを示す. D_{GaN} を減少すると, InGaN ナノコラムのときと同様に[3],高エネルギー側の成分(ナノコラ ムファセット部の量子井戸構造からの発光に対応)が減少し、ダブルピ ークからシングルピークに変化するが、移行するコラム径が InGaN ナノ コラムでは 120–130 nm であるのに対して、InGaN/GaN SQW では 62–76 nm と大きく異なることがわかった.

この原因を調べるために、GaN ナノコラム上に InGaN を(a-1) 2分、(a-2) 5分成長した InGaN/GaN ダブルヘテロ構造を作製して HAADF-STEM 観 察を行い、(b) 45分成長した InGaN ナノコラム構造との比較を行った(図 2). 成長時間が 2分の場合、島状成長によって GaN ナノコラムの頂上に 小さな InGaN 量子ドット (QD)構造が形成されていることがわかった. 成長時間を長くすると、横方向と高さ方向ともに成長していき[図 2(a-2)]、 直径が D_0 に達するまで横方向成長が進行するが、それ以上横方向に成長 することはできず[2]、高さ方向のみに成長すると推測される[図 2(b)]. したがって、 $D_{GaN}=D_0$ に到達する前に GaN 障壁層を形成すれば、直径 $D_{QD}(<D_0)$ の量子ドット (QD)構造が作製できる.一方 $D_{GaN} \leq D_{QD}$ を満た せば、量子ディスク構造となり、シングルピークの発光が得られると考 えられる.詳細な光学特性については当日に報告する. Wavelength (nm) 600 500 400 4 K $D_{GaN}=62 nm$ $B_{GaN}=62 nm$ 106 nm 2.0 2.5 3.0Photon Energy (eV)

Fig. 1: Normalized PL spectra at 4 K for InGaN nanocolumns on GaN nanocolumns with (a) D_{GaN} =62 nm, (b) D_{GaN} =84 nm, (c) D_{GaN} =106 nm.



Fig. 2: HAADF-STEM images of InGaN/GaN (a) double heterostructures and (b) InGaN nanocolumn. The growth times are (a-1) 2 min., (a-2) 5 min., and (b) 45 min., respectively.

謝辞:本研究は、科研費・特別推進研究(#24000013)の援助を受けて行われた.

[1] T. Kano, T. Oto *et al.*, Electron. Lett. **51**, 2125 (2015). [2] T. Oto *et al.*, AIP Advances **6**, 115214 (2016). [3] T. Oto *et al.*, IWN 2016, E0.4.05 (2016).